# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-107512

(43)Date of publication of application: 10.04.2002

(51)Int.CI.

GO2B 5/02

**B32B** 7/02 GO2F 1/1335

(21)Application number: 2000-302240

(71)Applicant: NITTO DENKO CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: SATAKE MASAYUKI

02.10.2000

SHIBATA HIROSHI

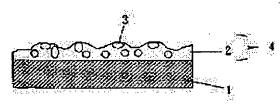
MATSUNAGA TAKUYA

SHODA TAKAMORI SHIGEMATSU TAKAYUKI

# (54) LIGHT DIFFUSIBLE SHEET AND OPTICAL ELEMENT

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light diffusible sheet having a light diffusing layer having sufficient image definition with which white unsharpness caused by surface dispersion is hardly seen by suppressing the glaring phenomenon of a screen while maintaining an antidazzle characteristic, and to provide an optical element provided with the light diffusible sheet. SOLUTION: In the light diffusible sheet formed with the light diffusing layer consisting of a resin film layer having a fine rugged shape at least on one side surface of a transparent substrate, the haze value of the light diffusible sheet is 40% or more, and the image definition measured with an optical comb having 0.5 mm width in JIS K7105 is 35 or more.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

27.06.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

Searching PAJ

decision of rejection

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-107512 (P2002-107512A)

(43)公開日 平成14年4月10日(2002.4.10)

(51) Int.Cl.7		識別記号	<b>₽</b> I		<del>;</del>	f-73-j*( <del>参考</del> )
G02B	5/02		G 0 2 B	5/02	В	2H042
B 3 2 B	7/02	103	B 3 2 B	7/02	103	2H091
G02F	1/1335		G 0 2 F	1/1335		4F100

## 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 6 頁)

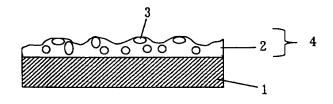
(21)出願番号	特願2000-302240(P2000-302240)	(71)出願人	000003964
	•		日東電工株式会社
(22)出顧日	平成12年10月 2 日(2000.10.2)		大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号
		(72)発明者	佐竹 正之
			大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東
			電工株式会社内
		(72)発明者	芝田 浩
			大阪府淡木市下穂積1丁目1番2号 日東
			電工株式会社内
		(74)代理人	100092266
			护理士 鈴木 崇生 (外4名)
			,
			•
			最終頁に統令

# (54) 【発明の名称】 光拡散性シート及び光学素子

### (57)【要約】

【課題】 防眩性を維持しつつ、画面のギラツキ現象を 抑え、かつ表面散乱による白ぼけが殆ど認めらず、像鮮 明性のよい光拡散層を有する光拡散性シート、さらには 当該光拡散性シートが設けられている光学素子を提供す ること。

【解決手段】 透明基板の少なくとも片面に、表面に微 細凹凸形状を有する樹脂皮膜層からなる光拡散層が形成 されている光拡散性シートにおいて、当該光拡散性シー トのヘイズ値が40%以上であって、かつJIS K7 105における0.5mm幅の光学くしで測定した像鮮 明性が35以上であることを特徴とする光拡散性シー



10

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板の少なくとも片面に、表面に微 細凹凸形状を有する樹脂皮膜層からなる光拡散層が形成 されている光拡散性シートにおいて、当該光拡散性シー トのヘイズ値が40%以上であって、かつJIS K7 105における0.5mm幅の光学くしで測定した像鮮 明性が35以上であることを特徴とする光拡散性シー

【請求項2】 樹脂皮膜層が微粒子を含有し、かつ樹脂 皮膜層の表面凹凸形状が微粒子によって形成されている ことを特徴とする請求項1記載の光拡散性シート。

【請求項3】 微粒子が有機系微粒子であることを特徴 とする請求項2記載の光拡散性シート。

【請求項4】 樹脂皮膜層が紫外線硬化型樹脂により形 成されていることを特徴とする請求項1~3のいずれか に記載の光拡散性シート。

【請求項5】 樹脂皮膜層がチクソトロピー剤を含有し ていることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載 の光拡散性シート。

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載の光拡散 性シートの樹脂皮膜層の凹凸形状表面に、樹脂皮膜層の 屈折率よりも低い屈折率の低屈性率層が設けられている ことを特徴とする光拡散性シート。

【請求項7】 請求項1~6のいずれかに記載の光拡散 性シートが、光学素子の片面又は両面に設けられている ことを特徴とする光学素子。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶ディスプレイ (LCD)、EL、PDPなどにおいて、画面の視認性 30 の低下を抑えるために用いられている光拡散性シート、 当該光拡散性シートが設けられている光学素子に関す る。

#### [0002]

【従来の技術】従来、LCDなどの画像表示装置は、表 示装置表面に蛍光燈などの室内照明、窓からの太陽光の 入射、操作者の影などの写り込みにより、画像の視認性 が妨げられる。そのため、ディスプレイ表面には、画像 の視認性を向上するために、表面反射光を拡散し、外光 の正反射を抑え、外部環境の写り込みを防ぐことができ る(防眩性を有する)微細凹凸構造を形成させた光拡散 層が設けられている。光拡散層の形成方法としては、構 造の微細化が容易なこと、また生産性がよいことから微 粒子を分散した樹脂をコーティングして樹脂皮膜層を形 成する方法が主流となっている。

【0003】しかし、高精細(たとえば、100ppi 以上)なLCDの場合に、上記光拡散層を装着すると、 光拡散層の表面で突出した粒子により形成される微細凹 凸構造に起因すると思われるギラツキ(輝度の強弱の部 分)がLCD表面に発生し視認性を低下させる問題があ 50 た、樹脂皮膜層に含有される微粒子は有機系微粒子であ

【0004】このギラツキ現象を改善するために、微細 凹凸構造表面をコントロールすると、ギラツキの改善と 共に、表面散乱が起こり表示画面が白っぽくなる、いわ ゆる白ぼけにより画面表示コントラストが低下するとい う問題や、透過画の像鮮明性が悪くなったりする問題が 生じる。たとえば、特開平11-326608号には光 拡散性シートの曇価(ヘイズ)を10%以上40%未 満、像鮮明性を50以上とすることにより、ギラツキを 防止できるという技術が開示されている。しかしなが **ら、当該技術は12.1インチXGA(106ppi)** でのギラツキ防止効果を有するに留まり、パネルがより 高精細化され、200ppi以上(例えば6インチ、X GA;210ppi)になっている場合には、ギラツキ の問題は解消されていない。

2

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、高精細なし CDに適用した場合にも、防眩性を維持しつつ、画面の ギラツキ現象を抑え、かつ白ぼけが殆ど認めらず、像鮮 明性のよい光拡散層を有する光拡散性シート、さらには 当該光拡散性シートが設けられている光学素子を提供す ることを目的とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは前記課題を 解決すべく鋭意検討を重ねた結果、以下に示す特性を有 する光拡散性シートにより前記目的を達成できることを 見出し、本発明を完成するに到った。

【0007】すなわち、本発明は、透明基板の少なくと も片面に、表面に微細凹凸形状を有する樹脂皮膜層から なる光拡散層が形成されている光拡散性シートにおい て、当該光拡散性シートのヘイズ値が40%以上であっ て、かつJIS K7105における0.5mm幅の光 学くしで測定した像鮮明性が35以上であることを特徴 とする光拡散性シート、に関する。

【0008】上記本発明の光拡散性シートはヘイズ値を 40%以上とし、像鮮明性を35以上とすることによ り、ギラツキ及び白ぼけを抑え、しかも像鮮明性を確保 している。ヘイズ値が40%未満では、高精細化した場 合のギラツキを抑えられない。ヘイズ値は40%以上と するのが好ましい。一方、ヘイズ値が高くなると透過率 が低下するため、ヘイズ値は60%以下が好ましい。ヘ イズ値は、特に40~50%とするのが好ましい。また 像鮮明性が35未満では透過画像がぼけるため、高精細 LCDを用いる場合に、その意味が低減する。像鮮明性 は40以上、特に40~60の範囲とするのが好まし

【0009】前記光拡散性シートにおいて、樹脂皮膜層 が微粒子を含有しており、かつ樹脂皮膜層の表面凹凸形 状が微粒子によって形成されていることが好ましい。ま

ることが好ましい。また、樹脂皮膜層が紫外線硬化型樹 脂により形成されていることが好ましい。さらには、樹 脂皮膜層がチクソトロピー剤を含有していることが好ま

【0010】微粒子を用いることにより、表面凹凸形状 を有する樹脂皮膜層を簡易かつ確実に実現でき、また上 記ヘイズ値、像鮮明性の調整も容易である。特に、微粒 子として有機系微粒子を用いた場合には、ギラツキを抑 えるうえで有効である。また、紫外線硬化型樹脂は紫外 線照射による硬化処理にて、簡単な加工操作にて効率よ 10 いられる。 く樹脂皮膜層(光拡散層)を形成することができる。さ らには、樹脂皮膜層の形成に当たり、チクソトロピー剤 を含有させることにより、樹脂皮膜層(光拡散層)の表 面において、突出粒子により微細凹凸構造を容易に形成 することができる。

【0011】また、本発明は、前記光拡散性シートの樹 脂皮膜層の凹凸形状表面に、樹脂皮膜層の屈折率よりも 低い屈折率の低屈性率層が設けられていることを特徴と する光拡散性シート、に関する。

【0012】低屈折率層により反射防止機能を付与で き、ディスプレイ等の画像表面の乱反射による画面の白 ぼけを有効に抑えることができる。

【0013】さらに、本発明は、前記光拡散性シート が、光学素子の片面又は両面に設けられていることを特 徴とする光学素子、に関する。

【0014】本発明の光拡散性シートは各種の用途に用 いることができ、たとえば、光学素子に用いられる。

【発明の実施の形態】以下に本発明の好ましい実施形態 を、図面を参照しながら説明する。図1は、微粒子3が 分散されている樹脂皮膜層2からなる光拡散層4が、透 明基板1上に形成されている光拡散性シートであり、樹 脂皮膜層2中に分散されている微粒子3は、光拡散層4 の表面において凹凸形状を形成している。 なお、図1で は、樹脂皮膜層2が1層の場合を示しているが、樹脂皮 膜層2と透明基板1との間には、別途、微粒子を含有す る樹脂皮膜層を形成することにより、光拡散層を複数の 樹脂皮膜層によって形成することもできる。

【0016】透明基板1としては、例えばポリエチレン テレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエ ステル系ポリマー、ジアセチルセルロース、トリアセチ ルセルロース等のセルロース系ポリマー、ポリカーボネ ート系ポリマー、ポリメチルメタクリレート等のアクリ ル系ポリマー等の透明ポリマーからなるフィルムがあげ られる。またポリスチレン、アクリロニトリル・スチレ ン共重合体等のスチレン系ポリマー、ポリエチレン、ポ リプロピレン、環状ないしノルボルネン構造を有するポ リオレフィン、エチレン・プロピレン共重合体等のオレ フィン系ポリマー、塩化ビニル系ポリマー、ナイロンや 芳香族ポリアミド等のアミド系ポリマー等の透明ポリマ 50 以上、特に3~6個有するアクリル系のモノマーやオリ

ーからなるフィルムもあげられる。さらにイミド系ポリ マー、スルホン系ポリマー、ポリエーテルスルホン系ポ リマー、ポリエーテルエーテルケトン系ポリマー、ポリ フェニレンスルフィド系ポリマー、ビニルアルコール系 ポリマー、塩化ビニリデン系ポリマー、ビニルブチラー ル系ポリマー、アリレート系ポリマー、ポリオキシメチ レン系ポリマー、エポキシ系ポリマーや前記ポリマーの ブレンド物等の透明ポリマーからなるフィルムなどもあ げられる。特に光学的に複屈折の少ないものが好適に用

【0017】透明基板1の厚さは、適宜に決定しうる が、一般には強度や取扱性等の作業性、薄層性などの点 より10~500µm程度である。特に20~300µ mが好ましく、30~200μmがより好ましい。

【0018】 微細凹凸構造表面を有する樹脂皮膜層 2 は、透明基板1上に形成されていれば、その形成方法は 特に制限されず、適宜な方式を採用することができる。 たとえば、前記樹脂皮膜層2の形成に用いたフィルムの 表面を、予め、サンドブラストやエンボスロール、化学 20 エッチング等の適宜な方式で粗面化処理してフィルム表 面に微細凹凸構造を付与する方法等により、樹脂皮膜層 2を形成する材料そのものの表面を微細凹凸構造に形成 する方法があげられる。また、樹脂皮膜層 2 上に別途樹 脂皮膜層を塗工付加し、当該樹脂皮膜層表面に、金型に よる転写方式等により微細凹凸構造を付与する方法があ げられる。また、図1のように樹脂皮膜層2に微粒子3 を分散含有させて微細凹凸構造を付与する方法などがあ げられる。これら微細凹凸構造の形成方法は、二種以上 の方法を組み合わせ、異なる状態の微細凹凸構造表面を 30 複合させた層として形成してもよい。前記樹脂皮膜層2 の形成方法のなかでも、微細凹凸構造表面の形成性等の 観点より、微粒子3を分散含有する樹脂皮膜層2を設け る方法が好ましい。

【0019】以下、微粒子3を分散含有させて樹脂皮膜 層2を設ける方法について説明する。 当該樹脂皮膜層 2 を形成する樹脂としては微粒子3の分散が可能で、樹脂 皮膜層形成後の皮膜として十分な強度を持ち、透明性の あるものを特に制限なく使用できる。前記樹脂としては 熱硬化型樹脂、熱可塑型樹脂、紫外線硬化型樹脂、電子 線硬化型樹脂、二液混合型樹脂などがあげられるが、こ れらのなかでも紫外線照射による硬化処理にて、簡単な 加工操作にて効率よく光拡散層を形成することができる 紫外線硬化型樹脂が好適である。

【0020】紫外線硬化型樹脂としては、ポリエステル 系、アクリル系、ウレタン系、アミド系、シリコーン 系、エポキシ系等の各種のものがあげられ、紫外線硬化 型のモノマー、オリゴマー、ポリマー等が含まれる。好 ましく用いられる紫外線硬化型樹脂は、例えば紫外線重 合性の官能基を有するもの、なかでも当該官能基を2個 5

ゴマーを成分を含むものがあげられる。また、紫外線硬化型樹脂には、紫外線重合開始剤が配合されている。

【0021】前記紫外線硬化型樹脂(樹脂皮膜層2の形成)には、レベリング剤、チクソトロピー剤、帯電防止剤等の添加剤を用いることができる。チクソトロピー剤を用いると、微細凹凸構造表面における突出粒子の形成に有利である。チクソトロピー剤としては、0.1μm以下のシリカ、マイカ等があげられる。これら添加剤の含有量は、通常、紫外線硬化型樹脂100重量部に対して、1~15重量部程度とするのが好適である。

【0022】微粒子3としては、各種金属酸化物、ガラス、プラスティックなどの透明性を有するものを特に制限なく使用することができる。例えばシリカやアルミナ、チタニアやジルコニア、酸化カルシウムや酸化錫、酸化インジウムや酸化カドミウム、酸化アンチモン等の導電性のこともある無機系微粒子、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリウレタン、アクリルースチレン共重合体、ベンゾグアナミン、メラミン、ポリカーボネート等の各種ポリマーからなる架橋又は未架橋の有機系微粒子やシリコーン系微粒子などがあげられる。これら微粒子3は、1種または2種以上を適宜に選択して用いることができるが、有機系微粒子が好ましい。微粒子の平均粒子径は1~10μm、好ましくは2~5μmである。

【0023】微粒子3を含有する樹脂皮膜層2の形成方法は特に制限されず、適宜な方式を採用することができる。たとえば、前記透明基板1上に、微粒子3を含有する樹脂(たとえば、紫外線硬化型樹脂:塗工液)を塗工し、乾燥後、硬化処理して表面に凹凸形状を呈するような樹脂皮膜層2により形成することにより行う。なお、塗工液は、ファンテン、ダイコーター、キャスティング、スピンコート、ファンテンメタリング、グラビア等の適宜な方式で塗工される。

【0024】形成した光拡散層4の表面のヘイズ値、像 鮮明性を前記範囲とするには、前記塗工液に含まれる微 粒子3の平均粒子径、その割合や樹脂皮膜層2の厚さを 適宜に調整する。

【0025】前記塗工液に含まれる微粒子3の割合は特に制限されないが、樹脂100重量部に対して、1~20重量部、さらには5~15重量部とするのが、ギラツ 40キ、白ぼけ等の特性を満足するうえで好ましい。また、樹脂皮膜層2の厚さは特に制限されないが、1~10 $\mu$ m程度、特に3~5 $\mu$ mとするのが好ましい。

【0026】前記光拡散層4を形成する樹脂皮膜層2の 凹凸形状表面には、反射防止機能を有する低屈折率層を 設けることができる。低屈折率層の材料は樹脂皮膜層2 よりも屈折率の低いものであれば特に制限されないが、 たとえば、フッ素含有ポリシロキサンなどの低屈折率材料を用いることができる。低屈折率層の厚さは特に制限 されないが、0.05~0.3μm程度、特に0.1~50

O. 3 u mとするのが好ましい。

【0027】また、前記図1の光拡散性シートの透明基板1には、光学素子を接着することができる(図示せず)。光学素子としては、偏光板、位相差板、楕円偏光板、光学補償付き偏光板等があげられ、これらは積層体として用いることができる。光学素子の接着は、必要に応じて、アクリル系、ゴム系、シリコーン系等の粘着剤やホットメルト系接着剤などの透明性や耐候性などに優れる適宜な接着層を介することができる。

【0028】偏光板としては、ポリビニルアルコール系フィルム、部分ホルマール化ポリビニルアルコール系フィルム、エチレン・酢酸ビニル共重合体系部分ケン化フィルム等の親水性高分子フィルムにヨウ素や染料等を吸着させて延伸したもの、ポリビニルアルコールの脱水処理物やポリ塩化ビニルの脱塩酸処理物の如き偏光フィルムがあげられる。位相差板としては、前記透明基板で例示したポリマーフィルムの一軸または二軸延伸フィルムや液晶ポリマーフィルムなどがあげられる。位相差板は、2層以上の延伸フィルムの重畳体などとして形成されていてもよい。楕円偏光板、光学補償付き偏光板は、偏光板と位相差板を積層することにより形成しうる。楕円偏光板、光学補償付き偏光板は、偏光板側の面に、光拡散層を形成している。

#### [0029]

【実施例】以下に、実施例によって本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によって何等限定されるものではない。

#### 【0030】実施例1

アクリル系の紫外線硬化型樹脂(ウレタンアクリレート系モノマー)100重量部に、平均粒子径が $3\mu$ mのポリスチレンビーズを15重量部、チクソトロピー剤(雲母)3重量部および光重合開始剤(商品名:イルガキュア907,チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製)3重量部をトルエンを介して混合し、50重量%に調整した塗工液をトリアセチルセルロースフィルム(厚み80μm)上に塗布し、120℃で5分間乾燥した後、紫外線照射により硬化処理して、厚さ約 $5\mu$ mの微細凹凸構造表面の樹脂皮膜層を有する光拡散性シートを作製した。

# 10 【0031】実施例2

実施例1において、微粒子として平均粒子径  $3 \mu m の \times 7$  ラミンビーズ 15 重量部を用いたこと以外は実施例 1 と同様にして光拡散性シートを作製した。

#### 【0032】実施例3

実施例1において、樹脂皮膜層の凹凸形状表面に、さらに樹脂皮膜層の屈折率(1.52)よりも屈折率の低い低屈折率層(材料として日産化学(株)のLR-202を使用、屈折率:1.39)を0.1μmを設けたこと以外は実施例1と同様にして光拡散性シートを作製し

50 to

7

#### 【0033】比較例1

実施例 1 において、微粒子として平均粒子径 3 . 5  $\mu$  m のシリカビーズ 1 5 重量部を用いたこと以外は実施例 1 と同様にして光拡散性シートを作製した。

### 【0034】比較例2

実施例1において、微粒子として平均粒子径3μmのメラミンビーズ1.5重量部を用いたこと以外は実施例1と同様にして光拡散性シートを作製した。

### 【0035】比較例3

実施例1において、微粒子として平均粒子径3μmのシ 10 リコーン粒子20重量部を用いたこと以外は実施例1と 同様にして光拡散性シートを作製した。

【0036】実施例および比較例で得られた光拡散性シートのヘイズ値、像鮮明性を測定した。なお、実施例3については低屈折率層を設けていない場合の値である。 結果を表1に示す。

【0037】 (ヘイズ) JIS-K7105に準じ、ヘイズメーター (東京電色工業社製モデルTC-H3DP) を用いて測定した。

【0038】 (像鮮明性) JIS K7105に準じ、スガ試験機製写像鮮明性測定装置により、0.5 mm幅の光学くしで測定した。

【0039】前記実施例および比較例で得られた光拡散\*

\*性シートに偏光板(185μm)を接着したものを、ガラス基板に接着し、ライトテーブル上に固定されたマスクパターン(6インチのXGAに相当するパターン(210ppi))上でギラツキ度合い(ギラツキ)を目視により以下の基準で評価した。またガラス基板の偏光板接着面と反対側の面に黒テープを貼りつけて、白ぼけを目視により以下の基準で評価した。また、上記ガラス基板上に文字を印刷した紙を置き、この文字を見た際の鮮明性を以下の基準で評価した。評価結果を表1に示す。なお、蛍光灯下における写り込み(防眩性)はいずれも

なお、蛍光灯下における写り込み (防眩性) はいずれも 良好であった。

【0040】ギラツキ、白ぼけ、鮮明性の評価は、目視にて10名が、

良好: 各特性に対して好印象である、

普通: 各特性に対して実使用上の影響を感じない、

不良:各特性に対して実使用上の影響を感じる、で判定 し、

◎:9人以上が良好、

〇:5人以上が良好、

×:3人以上が不良、と評価した。

[0041]

【表1】

	ヘイズ(%)	像鮮明性	白ぼけ	鮮明性	ギラツキ
実施例1	4 2	44	0	0	0
実施例 2	45	3 6	0	0	0
実施例3	4 2	44	0	0	0
比較例1	2 5	2 0	×	0	×
比較例 2	15	5 0	0	0	×
比較例3	4 2	1 5	×	×	0

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光拡散性シートの断面図の一例であ

る。

【符号の説明】

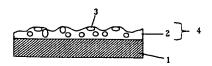
1:透明基板

2:樹脂層

3:微粒子

4:光拡散層

【図1】



# フロントページの続き

(72) 発明者 松永 卓也 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東 電工株式会社内

(72) 発明者 正田 位守 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東 電工株式会社内

(72) 発明者 重松 崇之 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東 電工株式会社内 F ターム(参考) 2H042 BA02 BA03 BA12 BA20 2H091 FA08X FA08Z FA11X FA11Z FA16X FA16Z FB02 FB11 LA16 4F100 AJ06 AK01B AK12 AT00A BA02 CA23B CA23H CA30 CA30B DD07B DE04B DE04H GB41 JB14B JN01A JN02B JN30 JN30B

and fine the company of the first of the contract of the contr